

$$E_0 = \frac{M_{ex}^3 \left[ x \left( 1 - \frac{x}{1-y} \right) \alpha_1^2 + y \left( 1 - \frac{y}{1-x} \right) \alpha_2^2 \right]^2}{c N^{2-6}}, \quad (2)$$

где  $\alpha_1 = dE_g/dx$ ,  $\alpha_2 = dE_g/dy$ ,  $c \approx 178$  — численный фактор [9].

Численные значения параметра  $E_0$  для исследованных образцов приведены далее в таблице.

Хвосты плотности состояний в твердых растворах  $Zn_xCd_yHg_{1-x-y}Te$

№ п/п	$x$	$y$	$x(1-x) +$ $+ y(1-y)$	$[x(1-x) +$ $+ y(1-y)]^2$	$E, \text{ мэВ}$ (при $T = 20 \text{ К}$ )	$E_0, \text{ мэВ}$ (эксп.) формула (1)	$E_0, \text{ мэВ}$ (теор.) формула (2)
1	0.16	0.07	0.200	0.040	246	1.5	3.4
2	0.18	0.07	0.213	0.045	290	2.1	4.0
3	0.20	0.07	0.225	0.051	364	3.0	5.0
4	0.18	0.12	0.253	0.064	377	1.8	4.8

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- [1] Sher Ard, Chen An-Ban, W. Espiser. J. Vac. Sci. Techn., 3, 105 (1985).
- [2] A. Ravid, A. Sher, A. Zissman. J. Appl. Phys., 68, 3592 (1990).
- [3] H. Mariette, R. Triboulet, V. Marfaing. J. Cryst. Growth., 86, 558 (1988).
- [4] A. Lusson, R. Legros, V. Marfaing, H. Mariette. Sol. St. Commun., 67, 851 (1988).
- [5] A. Lusson, F. Fuchs, V. Marfaing. J. Cryst. Growth., 101, 673 (1990).
- [6] Б. Л. Гельмонт, В. И. Иванов-Омский, В. А. Мальцева, В. А. Смирнов. ФТП, 15, 1109 (1981).
- [7] А. М. Андрухив, В. И. Иванов-Омский, К. Е. Миронов, Д. И. Цыпишка. Письма ЖТФ, 17, 55 (1991).
- [8] А. Г. Абдукадыров, С. Д. Барановский, С. Ю. Вербин, Е. Л. Ивченко, А. Ю. Наумов, А. Р. Резницкий. ЖЭТФ, 98, 2056 (1990).
- [9] С. Д. Барановский, А. Л. Эфрос. ФТП, 12, 2233 (1978).
- [10] А. М. Андрухив, О. А. Гадаев, В. И. Иванов-Омский, К. Е. Миронов, В. А. Смирнов, Ш. У. Юлдашев, Э. И. Цидильковский. ФТП, 26, 1288 (1992).

Редактор Ю. Б. Лянда-Геллер

ФТП, том 27, вып. 2, 1993

#### ВЛИЯНИЕ ЛЕГИРОВАНИЯ ГАЛЛИЕМ НА СВОЙСТВА ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ $Pb_{1-x}Ge_xTe$

Б. А. Акимов, А. В. Албул, И. И. Иванчик,  
Л. И. Рябова, Е. И. Слынько, Д. Р. Хохлов

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, 119899, Москва, Россия  
(Получено 9.07.1992. Принято к печати 20.07.1992)

В настоящее время известны несколько твердых растворов на базе теллурида свинца, в которых легирование галлием приводит к формированию примесного уровня, стабилизирующего положение уровня Ферми (УФ) внутри запрещенной зоны [1-3]. В  $PbTe$  (Ga) этот уровень расположен чуть выше середины запрещенной зоны. Приводимые в литературе значения энергии активации  $E_a \sim 130-140 \text{ мэВ}$  получены с использованием соотношения  $\rho \sim \exp(E_a/2kT)$  и,

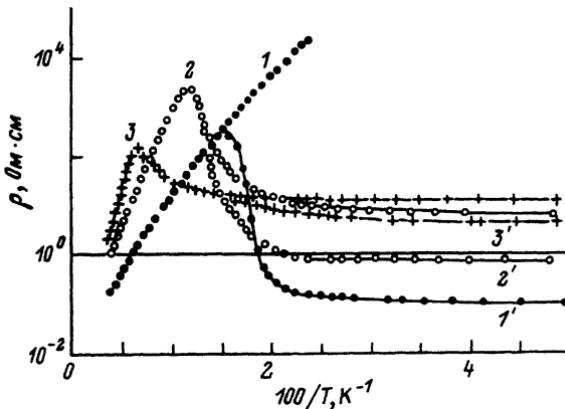


Рис. 1. Вид температурных зависимостей удельного сопротивления  $\rho$  монокристаллов  $Pb_{1-x}Ge_xTe(Ga)$  в условиях экранирования (1, 2, 3) и при подсветке тепловым источником (1', 2', 3'). 1, 1' —  $x = 0$ ; 2, 2' —  $x = 0.06$ ; 3, 3' —  $x = 0.11$ .

видимо, дают удвоенное значение глубины залегания примесного уровня, так как проводимость в этом соединении всегда остается электронной (см., [1] и ссылки в ней). Стабилизация положения уровня Ферми внутри  $E_g$  приводит к тому, что значения концентрации электронов в этих кристаллах оказываются близкими к собственным.

Интерес к этому соединению также связан с наблюдаемымся при  $T < T_c \sim 80$  К явлением задержанной фотопроводимости, обусловливающим эффект накопления неравновесных носителей в зоне проводимости при подсветке и весьма высокую фоточувствительность материала. Создание высокоомных твердых растворов на основе  $PbTe(Ga)$  позволяет расширить спектральный диапазон фоточувствительности как в область более длинных волн (в твердых растворах с отрицательным значением  $\partial E_g / \partial x$ , например, в  $Pb_{1-x}Sn_xTe$ ), так и в коротковолновую область спектра ( $Pb_{1-x}Mn_xTe(Ga)$ ,  $Pb_{1-x}Ge_xTe(Ga)$  [1-3]).

Относительно твердых растворов  $Pb_{1-x}Ge_xTe(Ga)$  известно лишь, что высокоомное состояние в них может быть реализовано [3], однако подробно эта система до настоящего времени не исследовалась.

Монокристаллические образцы  $Pb_{1-x}Ge_xTe(Ga)$  ( $x \leq 0.11$ ) были синтезированы сублимацией из паровой фазы. Состав  $x$  контролировался методом рентгеноносской дифрактометрии. Контакты наносились подпайкой сплавом  $In + 4\% Ag + 1\% Au$ . Измерения температурных зависимостей удельного сопротивления  $\rho$  проводились в вакууммируемой металлической камере, экраниющей образец от фоновых излучений. Подсветка осуществлялась с помощью миниатюрного теплового источника излучения с потоком на площадке образца  $\sim 10^{-8}$  Вт. На рис. 1 показан вид температурных зависимостей  $\rho$  ( $T$ ) для образцов  $Pb_{1-x}Ge_xTe(Ga)$  с  $x = 0$ ,  $x = 0.06$  и  $x = 0.11$  в условиях экранирования (кривые 1—3) и при подсветке тепловым источником (1'—3'). В области высоких температур для всех исследованных образцов наблюдается активационный рост  $\rho$ , энергия активации  $E_a$  составляет  $\sim 340$  мэВ в образце с  $x = 0.11$ ,  $\sim 280$  мэВ — с  $x = 0.06$  и  $\sim 140$  мэВ в  $PbTe(Ga)$ . В образцах, содержащих Ge, при некоторой температуре  $T_\Phi$  наблюдается резкий спад  $\rho$ . Значение  $T_\Phi$  зависит от состава сплава  $x$  и не меняется при вариации условий охлаждения. При  $x = 0.11$   $T_\Phi \sim 150$  К, при  $x = 0.06$   $T_\Phi \sim 85$  К. Явление задержанной фотопроводимости наблюдалось в кристаллах  $Pb_{1-x}Ge_xTe(Ga)$  при  $T \leq T_c = 80$  К. Величина  $T_c$  практически не зависит от  $x$  и совпадает с  $T_\Phi$  только в сплаве с  $x = 0.06$ . Как видно из рис. 1 относительная величина сигнала фотопроводимости падает с ростом  $x$ .

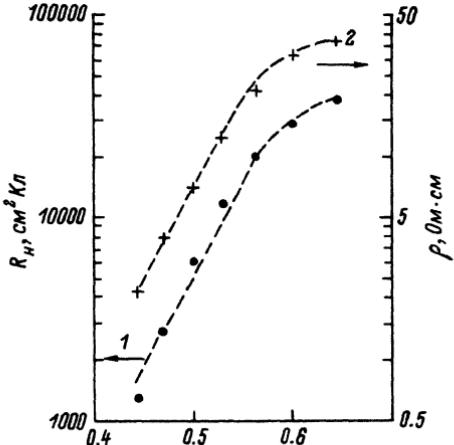


Рис. 2. Вид температурных зависимостей постоянной Холла  $R$  (1) и удельного сопротивления  $\rho$  (2) для образца  $Pb_{0.89}Ge_{0.11}Te(Ga)$ .

На рис. 2 представлены температурные зависимости постоянной Холла  $R$  (кривая 1) и, для сравнения,  $\rho$  (кривая 2) для кристалла с  $x = 0.11$ . Провести корректные измерения  $R$  удалось лишь в области температур  $T > T_\Phi$  (эти данные и приведены на рис. 2). Ниже температуры  $T_\Phi$  на холловских контактах образца появляется сигнал, не меняющийся при коммутации магнитного поля и существенно превышающий по величине собственно холловскую разность потенциалов. Подобные явления весьма характерны для неоднородных полупроводников, в которых производить расчет концентрации носителей заряда с помощью обычных соотношений неприемлемо. Аналогичный эффект был обнаружен и в образце с  $x = 0.06$ . Однако, как видно из рис. 2, при  $T > T_\Phi$  кривые  $R(T)$  и  $\rho(T)$  имеют активационный участок, отвечающий одной и той же энергии активации, а значение концентрации электронов при  $T = 224$  К составляет  $\sim 5.6 \cdot 10^{15} \text{ см}^{-3}$ .

Полученные экспериментально значения энергий активации при  $T_\Phi < T < 300$  К для образцов  $Pb_{1-x}Ge_xTe(Ga)$  практически совпадают с шириной запрещенной зоны в нелегированных кристаллах соответствующего состава [4]. В отличие от  $PbTe(Ga)$  наблюдать примесную активацию в этих кристаллах не удается, по-видимому, в связи с наличием аномалий на температурных зависимостях гальваномагнитных коэффициентов. Нам представляется наиболее разумным связать появление этих аномалий с имеющим место в  $Pb_{1-x}Ge_xTe(Ga)$  фазовым переходом. Это не значит, что температура фазового перехода в  $Pb_{1-x}Ge_xTe(Ga)$  совпадает с  $T_\Phi$ . Несмотря на то что  $T_\Phi$  зависит от состава сплавов  $x$  и  $[T_\Phi (x = 0.11) - T_\Phi (x = 0.06)]$  практически совпадает с известным из литературных данных значением разности температур фазовых переходов в нелегированных сплавах указанного состава [5], абсолютная величина  $T_\Phi$  для  $Pb_{1-x}Ge_xTe(Ga)$  на  $\sim 80^\circ$  ниже, чем температура фазового перехода в  $Pb_{1-x}Ge_xTe$ . Следует, однако, отметить, что и введение In в  $Pb_{1-x}Ge_xTe$  приводит к существенному понижению температуры фазового перехода [3]. В принципе при фазовом переходе происходит расщепление четырех эквивалентных долин, формирующих поверхность Ферми в  $PbTe$ . Однако сдвиг экстремумов составляет по порядку величины  $\sim 10$  мэВ, что могло бы привести лишь к некоторому изменению энергии активации проводимости. Эти изменения недостаточны для появления металлической проводимости в кристалле.

На наш взгляд, наиболее вероятной причиной, обусловливающей характер поведения кристаллов  $Pb_{1-x}Ge_xTe(Ga)$  при  $T < T_\Phi$ , является неустойчивость легирующего действия Ga в сплавах на основе  $PbTe$ . Так, в работе [6] было

обнаружено, что в  $Pb_{1-x}Ge_xTe$  (Ga) под действием гидростатического сжатия  $P$  в окрестности точки  $P_1$  наблюдался скачкообразный переход УФ из зоны проводимости в валентную зону, который связали с изменением зарядового состояния Ga и потерей его донорного действия под влиянием деформаций. В достаточно узком интервале внешних давлений вблизи  $P_1$  наблюдалась некоторая переходная область, характеризующаяся неоднородностью образца, связанной с наличием в его объеме областей с электронной и дырочной проводимостью. При этом температурные и полевые зависимости постоянной Холла были аналогичны наблюдаемым в  $Pb_{1-x}Ge_xTe$  (Ga) при  $T < T_\Phi$ .

Можно предположить, что напряжения, возникающие в кристаллической решетке сплавов  $Pb_{1-x}Ge_xTe$  (Ga) вследствие фазового перехода, способны индуцировать неоднородные по объему состояния, связанные с изменением легирующего действия Ga. Падение  $\rho$  при  $T < T_\Phi$  указывает на наличие некоторого канала протекания, в то время как поведение  $R$  свидетельствует о наличии существенных неоднородностей в объеме кристалла.

В заключение авторы благодарят В. Ф. Козловского за проведение рентгенодифрактометрического анализа образцов.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- [1] Б. А. Акимов, В. П. Зломанов, Л. И. Рябова, Д. Р. Хохлов. Высокочистые вещества, 6, 22 (1991).
- [2] Б. А. Акимов, С. А. Белоконь, Э. М. Дащевский, К. Н. Егоров, В. М. Лакеенков, А. В. Никорич, Л. И. Рябова. ФТП, 25, 250 (1991).
- [3] Г. С. Бушмарина, Б. Ф. Грузинов, И. А. Драбкин, Е. Я. Лев, И. В. Нельсон. ФТП, 11, 1874 (1977).
- [4] С. П. Гришечкина, С. В. Жоховец, Б. Д. Копыловский, А. П. Шотов. ФТП, 12, 1132 (1978).
- [5] А. И. Лебедев, Х. А. Абдуллин. ФТП, 18, 624 (1984).
- [6] Б. А. Акимов, Н. Б. Брандт, Л. И. Рябова, Д. Р. Хохлов, С. М. Чудинов, О. Б. Яценко. Письма ЖЭТФ, 31, 304 (1980).

Редактор Ю. Б. Лянда-Геллер

---

ФТП, том 27, вып. 2, 1993

#### СУПЕРИОННЫЕ СВОЙСТВА ПОЛУПРОВОДНИКА $Cu_{2-x}Se$ КАК ПРОЯВЛЕНИЯ ЭКСИТОННОЙ ФАЗЫ С ПЕРЕНОСОМ ЗАРЯДА

В. А. Федорин

Научно-исследовательский институт физики при Одесском государственном университете  
им. И. И. Мечникова, Одесса, Украина

(Получено 22.07.1992. Принято к печати 27.07.1992)

Полупроводниковые соединения  $A_2^I B^{VI}$  обладают рядом интересных физических особенностей [<sup>1, 2</sup>], что обуславливает их применение в технике в качестве термоэлектрических преобразователей энергии, переключателей, датчиков излучения и др. Все соединения указанного класса при повышении температуры переходят из  $\alpha$ - в  $\beta$ -фазу, характеризуемую высокой ( $\geq 1 \text{ Ом}^{-1} \text{ см}^{-1}$ ) ионной проводимостью. В настоящей заметке на примере соединения  $Cu_{2-x}Se$  рассматривается суперионный  $\alpha$ - $\beta$ -переход, как переход порядок—беспорядок по катионам в антифлюоритовой кристаллической структуре, в предположении